

<第 264 回講演会>

日 時： 2025 年 6 月 12 日(木) 13:00～17:00

会 場： オンライン(Zoom)での開催

テーマ： 『ナノインプリント技術の新展開』

フォトポリマー懇話会会員：無料(人数制限なし)

非会員：3,000 円、学生：2,000 円(6 月 5 日(木)までにお振り込みください)

テキストはダウンロード方式とします。

[参加申込]

フォトポリマー懇話会ホームページ www.tapj.jp のメールフォームからお申し込みください(6 月 6 日(木)締切)

[プログラム]

1. 13:00～13:50

「ナノインプリント技術の半導体、AR/VR デバイスへの新展開」

大阪公立大学 平井 義彦氏

2. 14:00～14:50

「ワーキングスタンプ作製用 UV ナノインプリント樹脂」

東洋合成工業(株) 大幸 武司氏

3. 15:00～15:50

「UV-NIL プロセス技術の開発：シリコンフォトニクスから AR グラスまで」

東京科学大学 雨宮 智宏氏

4. 16:00～16:50

「半導体デバイス製造用ナノインプリントリソグラフィの開発状況」

キヤノン(株) 伊藤 俊樹氏